

연수 제안서

연구 분야	모놀리식 3차원 집적을 위한 저온 상부소자층 형성 및 소자 기술 개발
연구 과제명	차세대 대면적 3차원 모놀리식 집적을 위한 저온공정 기반 실리콘/저마늄 채널 상부응용소자 제작 기술 개발 및 회로/아키텍처 구현
연수 제안 업무	<ul style="list-style-type: none">● Seed 층 상에 실리콘 및 저마늄 에피 성장● 비정질 ILD 상의 결정질층 성장● source/drain engineering● 소자의 전기적 특성 평가
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2024.09.01.~2025.08.31.</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. 실리콘/저마늄 저온 에피 성장 및 이를 이용한 FET 소자 기술 개발2. 비정질 ILD 상의 결정질층 성장3. gate 및 source/drain 형성 공정 및 소자의 전기적 특성 평가	
연수 책임자 : 김 형 준	